## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-220687 (43)Date of publication of application: 05.08.2004

(51)Int.CI.

611B 7/24

(21)Application number: 2003-006292

(71)Applicant: SAMSUNG JAPAN CORP

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED

INDUSTRIAL & TECHNOLOGY

TOK CORP

(22)Date of filing:

14 01 2003

(72)Inventor:

KIN SHUKO TOMINAGA JUNJI

KIKUKAWA TAKASHI

(54) RECORDING MEDIUM OF SUPERRESOLUTION NEAR FIELD STRUCTURE, RECORDING METHOD AND REPRODUCING METHOD THEREOF, RECORDING APPARATUS AND REPRODUCING APPARATUS OF THE SAME (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a recording medium of a superresolution near field structure for reproducing a signal from a small recording mark size by using a red laser and a low power laser beam, a recording method and a reproducing method thereof, and a recording apparatus and a reproducing apparatus for the same SOLUTION: The recording medium has a structure, in which a polycarbonate layer, a second dielectric body layer, a highly flexible second high flexibility layer having a melting point near by recording power, a rigid second protective layer, a recording layer, a rigid first protective layer, a highly flexible first high flexibility layer having a melting point near by the recording power and a first dielectric body layer are layered sequentially. When a laser beam is irradiated to the recording layer constituted of a platinum oxide, a palladium oxide or a silver oxide. the recording layer is thermally decomposed, and a cavity having particles of platinum, palladium or silver and oxygen is formed, recording for writing

is carried out by expanding in volume on both sides in the directions of



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14 01 2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

the first and the second high flexibility layers.

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19) 日本国特許庁(JP)

## (2)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2004-220687 (P2004-220687A)

(43) 公開日 平成16年8月5日(2004.8.5)

(51) int. Cl. 7		FI				テーマコー	ド (参考)	
G11B 7	7/24	G11B	7/24	522U		5D029		
		G11B	7/24	511				
		G11B	7/24	526G				
		G11B	7/24	533A				
		GIIB	7/24	533M				
		<b>藝</b> 童語才	有請求	項の数 20	ΟL	(全 11 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号		特顧2003-6292 (P2003-6292)	(71) 出題人	50035670	16			
(22) 出願日		平成15年1月14日 (2003.1.14)	*式会社					
			東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号 浜町センタービル					
			30102153	301021533				
				独立行政法人産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関1-3-1				
			(71) 出願人	出版人 000003067				
				TDK株	式会を	ŧ		
			東京都中央区日本橋1丁目13番15				3番1号	
			(74) 代理力					
				弁理士		忠彦		
			(72) 発明者					
				茨城県つ 式会社内		5東1-1-1	三星電子株	
				- CAN IT P	'	氣	<b>M</b> 終頁に続く	

(54) [発明の名称] 超解像度近接場構造の記録媒体、記録方法及び再生方法、及び記録装置及び再生装置

## (57) 【要約】 (修正有)

【課題】赤色レーザ…を用いて小さい記録マークサイズ から信号を安定に、また低いパワーのレーザービームで 再生することができる、超解像更近接場構造の記録媒体 、記録方法及び再生方法、及び記録装置及び再生装置を 接供する。

【解決手段】ボリカーボネート層、第2誘電体層、記録パワー近所に拠点を有する高軟性の第2高軟性層、硬性の第1保護層、記録パワー近所に減点を有する高軟性の第1保護層、記録パワー近所に減点を有する高軟性の第1高軟性層、第1誘電体層が順次報層された構成からなり、酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームが財針されて、前記記録層が幾分解され、前記記録層で自金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有する空洞が彩成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向との両側に体報膨張されることによって書き込みをする記録がなされる。

【選択図】	义	3
-------	---	---

	第1額電件層	~260
	作1高教性	~270
	第1保護費	~280
	記録階	~250
	第2保護曆	230
	第2高軟性層	~220
	第2誘軍休居	~210
7	ポリカーボネート層	₹200

30

50

【特許請求の範囲】

【清水項1】

ボリカーボネート階、第2 誘電係層、記録パワー近所に融点を有する高軟性の第2 高駄性 層、硬性の第2 保護層、記録層、硬件の第1 保護層、記録パワー近所に融点を有する高軟 性の第1 高軟性層、第1 誘電体層が順火精層された構成からなり、

酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録編にレーザービームが照射されて、 前記記録欄が熱分解され、前記記録欄に白金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有す 全元前が形成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向との両側に体 機影振を有することを特徴とする程解像度近接場構造の記録媒体。

【請求項2】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層は400℃~700℃の腰点を有することを特徴とする請求項1に記載の超解像度近接場構造の記錄媒体。

【請求項3】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層はAgwInxSbyTez、或いはSbxTeyであることを特徴とする請求項2に記載の超解像度近接場構造の記録媒体。

【請求項4】

前記第2保護層と前記第1保護層は2nS-SiO₂であることを特徴とする請求項1に記載の超解像度近接場構造の記録媒体。

【請求項5】

ポリカーボネート層、第2該電体階、記録パワー近所に融点を有する高軟性の第2高軟性 層、硬性の第2保護層、記録層、硬性の第1保護階、記録パワー近所に融点を有する高軟 性の第1高軟性層、第1該電体層が順次積層された構成からなる超解像度近接場構造の記 録数体に書き込みをする記録方法であって、

酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて、 前記録層が熱分解され、前記記録層に白金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有す る空洞が形成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向との両側に体 策膨張されることによって前記記録媒体が記録されることを特徴とする記録方法。

【請求項6】

前記第2高軟性層と前配第1高軟性層に400℃~700℃の記録パワーを与えることを 特数とする請求項5に記載の記録方法。

【請求項7】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層はAgwInxSb,Tez、或いはSbxTeyであることを特徴とする請求項6に記載の記録方法。

【請求項8】

前記第2保護層と前記第1保護層はZnS-SiO2であることを特徴とする請求項5に記載の記録方法。

【請求項9】

ポリカーボネート層、第218000体階、記録パワー近所に離点を有する高軟性の第2高軟性 個、 既性の第2 保護層、記録層、硬性の第1 保護階、記録パワー近所に融点を有する高軟 他の第1 高軟性層、第1 1800年階が順次積層された構成からなる超解像度近接場構造の記 録機体に書き込みをする記録装置であって、

酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームを照射して、前記記録層を熱分解し、前記記録層に白金、パラジウム、或いは銀の粒子と散素を有する空 野部である時、前記第1 高軟性層の方向と前記第2 高軟性層の方向との両側に、該空洞 を体積膨張させることによって前記記録媒体を記録することを特徴とする記録整層、

【請求項10】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層に400℃~700℃の記録パワーを与えることを 特徴とする請求項9に記載の記録装置。

【請求項11】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層はAg。InェSb,Teェ、或いはSbェTe,

40

であることを特徴とする請求項10に記載の記録装置。

【請求項12】

前記第2保護層と前記第1保護層はZnSーSiO2であることを特徴とする請求項9に記載の記録装置。

[請求項13]

ポリカーボネート層、第 2 誘電体層、記録パワー近所に融点を有する高軟性の第 2 高軟性 層、硬性の第 2 高限に限温、硬性の第 1 新理性の第 1 高軟性層、混誤層、混誤層、記録層、記録層、記録層、記録層、記録層、記録層、記録層、記録層、記録層、表現代の立めり、酸化白金、酸化の分り、丸、水のは酸化銀の前配記録層にレーザービームが照射されて、前記記録層が形成される時、水前記記録層に自金、パラジウム、皮いは銀の竣子と酸素を有する空洞が形成される時、水前部第 1 高軟性層 の方向と前記第 2 高軟性層の方向の両側に体積膨張される時、って記録されている 超解像度近接場構造の記録媒体から読み出しをする再生方法であって

再生のためのレーザービームを照射して、前記記録層の空调に有されている白金、パラジ ウム、或いは銀の粒子の相互作用による局所表面近接場によって超解像度近接場を発生さ せて読み出しをすることを特徴とする再生方法。

【請求項14】

前記記録レーザービームによって前記第2高軟性層と前記第1高軟性層に400℃~70 0℃の記録パワーが与えられたことを特徴とする請求項13に記載の再生方法。

【請求項15】

前記第2高軟性層と前記第1高軟性層はAgyIngSbyTeg、或いはSbgTeyであることを特徴とする請求項14に記載の再生方法。

【請求項16】

前記第2保護層と前記第1保護層はZnS-SiO2であることを特徴とする請求項13 に記載の再生方法。

【請求項17】

1800 ホスェート層、第2誘電体層、記録パワー近所に設点を有する高軟性の第2高軟性層、硬性の第2保護層、記録層、硬性の第1保護層、記録パワー近所に破点を有する高軟性の第1高軟性層、第1誘電体層が順次積層された構成からなり、整化白金、酸化パラジウム、咳は酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて、前記記録層が熱分解され、前記記録層に白金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有する空洞が形成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向との両側に体積膨張されることによって記録されている超解像度近接場構造の記録媒体からの読み出しをする再生装置であって、

再生のためのレーザービームを照射して、前記記録層の空調に有されている白金、パラジウム、或いは銀の位子を相互作用させて局所表面近接場を起こすことによって超解像度近接場を発生させて読み出しをすることを特徴とする再生装置。

【請求項18】

前記記録レーザービームによって前記第2高軟性層と前記第1高軟性層に400℃~70 0℃の記録パワーが与えられたことを特徴とする請求項17に記載の再生装置。 【競求項19】

前記第2高駄性層と前記第1高駄性層はAg。In、Sb,Te。、或いはSb、Te,であることを特徴とする請求項18に記載の再生装置。

【請求項20】

前記第2保護層と前記第1保護層はZnS-SiO2であることを特徴とする請求項17に記載の再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は超解像度近接場構造の記録媒体、記録方法及び再生方法、及び記録装置及び再生

20

50

模置に係り、特に、酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前起配録層にレーザービームが照射されて、前配配録層が熱分解され、前配配銀層に白金、パラジウム、或いは銀の方向と酸素を有する空洞が形成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2高軟性層の方向との両側に体積膨張されることによって書き込みをする記録がなされ、再生のためレーザービームを照射して、前記記録層の空洞に有されている白金、パラジウム、或いは銀の粒子の相互作用による局所表面近接場によって超解像度近接場を発生させて読み出しまする再年がなされる。

[0002]

【従来の技術】

従来の記銭媒体は大きく分けて光磁気記録方式の記録媒体と相変化記録方式の記録媒体が ある。

[0003]

光磁気記録方式の記録集体はMD(Mini Disk)のように磁性体に直線傷光を入 前させれば、磁性体の磁気大きさ及び磁気方向に応じて、その反射光が回転する現象であ る磁気のカー効果を利用する記録集体である。

[0004]

相変化記録方式の記録媒体はDVD(digital versatile disk)のように記録媒体の記録された領域と記録されない領域の非晶質と結晶質の結晶状態による光常数の吸収係数の意によって発生される反射率の差を利用する記録媒体である。また、最近には相変化記録方式の一種で積小マークを利用して記録媒体に記録し、記録媒体から固折限界以下で再生するためのさぎまな方式が提示されている。その中で一番注目されているのが超解後近接場構造の記録媒体として第63回応用物理学会講演予稿集のページ1005と、200年9月24日~27日に日本国新設大学で行われた学会で発表されたのを従来の程解像度近接場構造の記録媒体として日本国新設大学で行われた学会で発表されたのを従来の程解像度近接場構造の記録媒体としてある。

[00051

図1は従来の超解像度近接場構造の記録媒体の構造を示す図である。

[0006]

[0007]

[0008]

図 2 は図 1 の超解像度近接場構造の記録媒体にレーザービームが照射されて記録がなされた部分を詳細に示す図である。

[0009]

図2に示されているように、レーザービームが照射される部分において、レーザービームのパワー分布で示されているように、中央部分はレーザービームのパワーが高い。記録数 体において、レーザービームが照射される部分の中央部分のように、所定値以上のパワーのレーザービームが照射される部分の記録層 150は熱分解され、所定値以上のパワーのレーザービームが照射されない部分の記録層 150は熱分解されない。すなわち、所定値 以上のパワーのレーザービームが照射される部分の記録層は熱分解されて書き込みが行われ、所定値以上のパワーのレーザービームが照射されない部分の記録層は熱分解されなくて書き込みが行われない。記録層150が熱分解されることによって記録層150に白金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有する空調が、高軟性層170次円の戸側に、凸状に形成される。この時、硬性の保護層1806記録層150と同様に、高軟性層170の方向に凸状になる。しかし、記録パワー近所に融点を有する高軟性の高軟性層170の方向に凸状になるようにならないで、平らな形状でのままである。

[00101

上記のようにして記録がなされた記録媒体から読み出しをする再生について説明する。記録媒体の記録より低いパワーのレーザービームが連接的に照対される時、図2に示されているように、記録されている部分にレーザービームが連まされた。記録を150の空洞に有されている部分に所定値以上のパワーのレーザービームが照射され、記録層 150の空洞に有されているが会全、パラジウム、或いは銀の粒子の相互作用による局所表面近接場によって穏解像度近接を発生させる。これによって、記録されているといる分における光常数の吸収係数の差によって発生される反射率の差を利用する読み出しをする。

[0011]

しかし、上記の超解像定近接場構造の記録媒体は次世代の20Gb級の記録媒体を赤色レーザーで達成するのに不充分である。すなわち、赤色レーザーを用いて100nmの記録マークサイズから信号を40dB以上で安定に読み出しをする再生が不充分である。 【0012】

【登明が解決しようとする課題】

本発明は、青色レーザーを用いなく、レンズの閉口率を増加しなくても、赤色レーザーを 用いて100nmの記録マークサイズから信号を40dB以上で安定に、また低いパワー のレーザービームで再生することができる、特に、100nmの記録マークサイズから信 号を3mWの再生パワーで45dB以上で再生することができる、超解像度近接場構造の 記録媒体、記録方法及び再生方法、及び記録装置及び再生装置を提供する。

[0013]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するための本発明は、超解像度近接編構造の記録集体の観点から、ポリカーボネート層、第 2 誘電体層、記録パワー近所に融点を有する高軟性の第 2 高軟性層、促性の第 2 保護層、記録パワー近所に融点を有する高軟性層、第 1 誘電体層が順次積層された構成からなり、酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて、前記記録層が熱分解され、前記記録層、パラジウム、或いは酸化銀の直接を有する空渦が形成される時、前記記録層に白金、パラジウム、或いは酸化量と酸素を有する空渦が形成される時、前記影響 1 高軟性層の方向と前記第 2 高軟性層の方向との両側に体積膨張を有する。

[0014]

また、本発明の記録媒体において、前記第2高軟性層と前記第1高軟性層は400℃~700℃の融点を有する。

[0015]

上記の目的を達成するための本発明は、超解像度近接場構造の記録集体に書き込みをする 記録方法の概点から、ポリカーボネート層、第2該電体層、記録F75ー近所に酸点を有す る高軟性の第2高軟性の第2保護層、記録F86を開発を設備を開発を 所に設点を有する高軟性の第1所では 解像度近接場構造の記録解体に書き込みをする記録方法であって、数化白金、酸化パケラ ウム、或いは酸化銀の新記記録層にレーザービスが照射されて、前記記録序が熱分る時 力、、或いは酸化銀の新記記録層にレーザービスが照射されて、前記記録解が熱分る時 れ、前記記録層に自金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有する空洞が形成されるる ので前記記報層にあたせ層の方向との両側に体積膨張されることによって前記記録媒体が記録される。

[0016]

20

30

また、本発明の記録方法において、前記第2高軟性層と前記第1高軟性層に400℃~700℃の記録パワーを与える。

[0017]

[8100]

また、本発明の記録装置において、前記第2高軟性層と前記第1高軟性層に400℃~700℃の記録パワーを与える。

[0019]

上記の目的を達成するための本発明は、超解像度近接場構造の記録機体から読み出出しをする再生方法の親点から、ポリカーボネート層、第2器電体層、記録パワー近所に融点を有する高軟性の第2 高軟性原係。2 保護層、記録層、硬性の第1 保護層、配録がらなり、酸化血金、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて、前記記録層が自立。、酸化パラジウム、或いは酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて、前記記録層が含まる。 前記第1高軟性層の方向と前記第2 高軟性層の方向との両側しを変複が影成される時、前記第1高軟性層の方向と前記第2 赤性層の方向との両側しを変を指することによって記録されている超解像度が表達といます。

100201

また、本発明の再生方法において、前記記録レーザービームによって前記第2高軟性層と 前記第1高軟性層に400℃~700℃の記録パワーが与えられている。

100211

10021 上記の目的を達成するための本発明は、超解像便近接場構造の記録媒体から読み出しをする再生装置の観点から、ポリカーボネート層、第2 誘電体層、記録パワー近所に融点をする高軟性の第2 高軟性の第2 保護層、記録電体層、硬性の第1 保護層、総践パワー 近所に融点を有する高軟性の第1 高軟性層、第1 記載電体層が順次検層された構成からなり、酸化白金、酸化パラジウム、或以は酸化銀の前記記録層にレーザービームが照射されて前記記録層が終分解され、前記記録層にし金、パラジウム、或いは銀の粒子と酸実を有する空洞が形成される時、前記記録層に自金、パラジウム、或いは銀のを子とで高軟性層の媒体からの前込み出る空間が表であって、再生のためのレーザービームを照射して、前記記録層の空洞とする事生装置であって、再生のためのレーザービームを照射して、前記記録層の空洞とするよれている自金、パラジウム、或いは銀の粒子とで上までに関係を配近接場を起こすことによって複解像度近接場を発生させて確み出しをする。

10022

また、本発明の再生装置において、前記記録レーザービームによって前記第 2 高軟性層と前記第 1 高軟性層に 4 0 0 ℃~ 7 0 0 ℃の記録パワーが与えられている。

[0023]

また、本発明の超解像度近接場構造の記録媒体、記録方法及び再生方法、及び記録装置及び再生波置において、前記第2高軟性層と前記第1高軟性層はAg。In\_Sb,Te.、 軟いはSb\_Te,であり、また、前記第2保護層と前記第1保護層は2nS-SiO,である。

30

50

[0024]

このように本発明によると、赤色レーザーを用いて100nmの記録マークサイズから信号を40dB以上で安定に再生することができる。

[0025]

【発明の実施の形態】

上述した目的を達成するための本発明の構成とその作用を添付図面により詳細に説明する

10026

図3は本発明による超解像度近接場構造の記録媒体の構造を示す図である。

[0027]

図 3 に示すように、本発明による超解像度近接場構造の記録媒体は、ポリカーボネート層 2 0 0 、 Z n S -S i O Z p f o

100281

10 2 6 1 本発明による超解像度近接場構造の記録媒体は、酸化白金、酸化パラジウム、或いは酸化 銀の記録層 2 5 0 に、2 n S - S i O 2 からなる硬性の第 1 保護層 2 8 0 と 第 2 保護層 2 3 0 の融点よりはるかに低い4 0 0 で~7 0 0 での記録パワーを有するレーザービームが 照射されて、記録層 2 5 0 が熱分解され、記録層 2 5 0 に白金、パラジウム、或いは銀の 短子と酸素を有する空洞が形成される。この時、第 1 高軟性層 2 7 0 の方向と第 2 高軟性 層 2 2 0 の方向との両側に体験膨張されることによって記録される。ここで、第 1 保護層 2 8 0 は記録層 2 5 0 と 6 1 高軟性層 2 7 0 との反応を防止し、第 2 保護層 2 3 0 は記録 層 2 5 0 と 5 2 高軟性層 2 2 0 との反応を防止し、第 2 保護層 2 3 0 は記録

[0029]

図4は図3の超解像度近接場構造の記録媒体にレーザービームが照射されて記録がなされた部分を詳細に示す図である。

[0030]

図もに示されているように、レーザービームが照射される部分において、レーザービーム のパワー分布で示されているように、中央部分はレーザービームのパワーが高い。記録媒 体において、レーザービームが照射される部分の中央部分のように、所定値以上のパワー のレーザービームが照射される部分の記録層250は熱分解され、所定値以上のパワーの レーザービームが照射されない部分の記録層250は熱分解されない。すなわち、所定値 以上のパワーのレーザービームが照射される都分の記録層は熱分解されて書き込みが行わ れ、所定値以上のパワーのレーザービームが照射されない部分の記録層は熱分解されたく て書き込みが行われない。記録層250が熱分解されることによって記録層250に白金 、パラジウム、或いは銀の粒子と酸素を有する空洞が、第1高軟性層270の方向と第2 高軟性層220の方向との両側に、凸状に形成される。この時、硬性の第1保護層280 も記録層250と同様に、第1高軟性層270の方向に凸状になり、硬性の第2保護層2 30も記録層250と同様に、第2高軟性層220の方向に凸状になる。しかし、記録パ ワー近所に融点を有する高軟性の第1高軟性層270は、記錄層250が第1高軟性層2 70の方向に凸状になるようにならないで、平らな形状そのままであり、また、記録パワ 一近所に融点を有する高軟性の第2高軟性層220は、記録層250が第2高軟件層22 0の方向に凸状になるようにならないで、平らな形状そのままである。

[0031]

このように本発明によって記録された超解像度近接場構造の記録媒体における記録層の空洞は、前記従来の超解像度近接場構造の記録媒体における記録層の空洞より、多い白金.

パラジウム、或いは銀の粒子を有することができるようになる。これによって、本祭明は 、従来に比べて、読み出しを行う再生時におけるレーザービームがより多く相互作用され て局所表面近接場が生じるので、より強い超解像度近接場が形成されて、より小さい記録 マークサイズであっても安定に読み出しをする再生がなされることができる。

[0032]

上記のようにして記録がなされた記録媒体から読み出しをする再生について説明する。記 録媒体の記録より低いパワーのレーザービームが連続的に照射される時、図4に示されて いるように、記録されている部分にレーザービームが当たった時、記録されている部分に 所定値以上のパワーのレーザービームが照射され、記録層250の空洞に有されている白 金、パラジウム、或いは銀の粒子の相互作用による局所表面近接場によって超解像度近接 場を発生させる。これによって、記録されている部分と記録されていない部分における光 常数の吸収係数の差によって発生される反射率の差を利用する読み出しをする。

[0033]

図5は記録マークサイズによるCNR (Carrier to Noise Ratio )を示すグラフ図である。

[0034]

図5においてグラフ図は、記録媒体は液長635nmと開口率0.6を有する赤色レーザ ーを用いて12mWのパワーで記録し、この赤色レーザーを用いて3、5mWのパワーで 再生した時の記録マークサイズによるCNRである。図5に示されているように従来の記 銀媒体である図1の構造の記録媒体は170mm以下の記録マークサイズではCNRが4 OdB以下を示しており、また記録マークサイズが小さくなるによってCNRが急に落ち ている。しかし、本発明の記録媒体である図3の構造の記録媒体は約80ヵm以上の記録 マークサイズではCNRの変化があまりなく、またCNRが42dB以上を示している。

10

[0035]

従って、本発明によると、赤色レーザーを用いて100nmの記録マークサイズから信号 を40dB以上で安定に読み出しをする再生ができる。

[0036]

図6は読み出しをする再生時レーザービームのパワーによるCNRを示すグラフ図である

30

[0037]

図6においてグラフ図は、記録媒体は液長635ヵmと開口率0.6を有する赤色レーザ ーを用いて l 2 m W のパワーで、記録マークサイズを 1 0 0 n m 記録し、この赤色レーザ ーを用いて再生した時の再生パワーによるCNRである。図6に示されているように従来 の記録媒体である図1の構造の記録媒体は4mWの読み出しパワーで約30dBを示して おり、また読み出しパワーが小さくなるによってCNRが急に落ちている。しかしながら . 本発明の記録媒体である図3の構造の記録媒体は約3mW以上の読み出しパワーではC NRの変化があまり大きくなく、またCNRが45dB以上を示している。

[0 0 3 8 ]

従って、本発明によると、赤色レーザーを用いて100nmの記録マークサイズから信号 を約3mWの読み出しパワーでも40dB以上で安定に読み出しをする再生ができる。 更 に、読み出しをする再生時レーザービームのパワーが低いので電力消耗が低減される。ま た、更に読み出しをする再生時レーザービームのパワーが低いので記録媒体の耐久性が向 上する。

[0039]

【発明の効果】

上記のように、本発明は赤色レーザーを用いて100ヵmの記録マークサイズから信号を 4 0 d B 以上で安定に再生する効果を有する。また、赤色レーザーを用いて 1 0 0 n m の 記録マークサイズから信号を約3mWの読み出しパワーでも40dB以上で安定に再生す る効果を有する。特に、100nmの記録マークサイズから信号を3mWの再生パワーで 4 5 d B 以上の再生特性が得られるので即時実用化が可能である。更に、読み出しをする

再生時レーザーピームのパワーが低いので電力消耗が低減される効果を有する。また、更 に記み出しをする再生時レーザーピームのパワーが低いので記録媒体の耐久性が向上する 効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は従来の超解像度近接場構造の記録媒体の構造を示す図である。

【図2】図2は図1の超解像度近接場構造の記録媒体にレーザービームが照射されて記録がなされた部分を詳細に示す図である。

【図3】図3は本発明による超解像度近接場構造の記録媒体の構造を示す図である。

【図4】 図4は図3の超解像度近接場構造の記録媒体にレーザービームが照射されて記録がなされた部分を詳細に示す図である。

【図5】図5は記録マークサイズによるCNRを示すグラフ図である。

【図6】図6は読み出しをする再生時レーザービームのパワーによるCNRを示すグラフ 図である。

【符号の説明】

100 ポリカーボネート層

110 第2誘電体層

150 記錄層

160 第1誘電休層

170 高軟性層

180 保護層

200 ポリカーボネート層

210 第2誘電体層

220 第2高軟性層

230 第2保護層

250 記録層

260 第1誘電体層

270 第1高軟性層

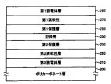
280 第1保護層

20

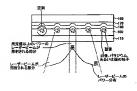
[ X 1 ]



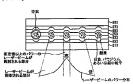
[図3]



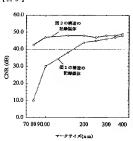
[図2]



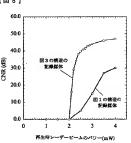
[図4]



[図5]



[図6]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

FΙ

G11B 7/24 533Z G11B 7/24 534N G11B 7/24 535H

テーマコード (参考)

(72) 発明者 富永 淳二

茨城県つくば市東1−1−1 独立行政法人産業技術総合研究所内

(72) 発明者 菊川 隆

茨城県つくば市東1-1-1 ティーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 5D029 JA01 JB23 JC11 KA07 LA17 LB11 NA23 NA24